

國立交通大學

電子物理研究所

碩士論文

氮化鎵厚膜之選擇性化學

蝕刻特性研究

Selective Chemical Etching Characteristics of GaN

Thick Film

研究生：曾虹諭

指導教授：李威儀 教授

中華民國九十五年七月

氮化鎵厚膜之選擇性化學蝕刻特性研究

Selective Chemical Etching Characteristics of GaN Thick Film

研 究 生：曾虹諭

Student: Hung-Yu Zeng

指導教授：李威儀 博士

Advisor: Dr. Wei-I Lee

國立交通大學

電子物理研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Electro-Physics

College of Science

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

In

Electro-Physics

July 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十五年七月